

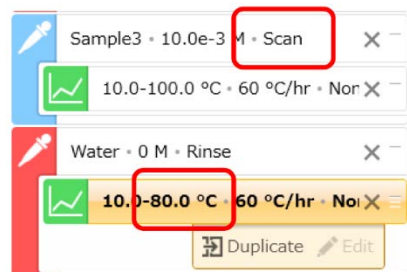
MicroCal PEAQ-DSC Automated のメンテナンス方法

定期的なシステム洗浄は良好な測定に必要です。汚れは蓄積しますとベースラインノイズ発生等の原因になります。ここではシステムの汚れを防ぐことに必要なメンテナンスについてご案内しております。

- ◆システムの洗浄方法はサンプルにより異なります。そのためユーザーによる至適化が必要です。
- ◆メンテナンスで使用する試薬の中には劇物に該当するものもございます。特に昇温した場合には十分な注意が必要です。取扱い時は、手袋、保護眼鏡をご使用ください。
- ◆使用されない場合でも 1 ヶ月に 1 度は Maintenance から Wash を選び、洗浄を行うようにしてください。
- ◆サンプルは測定に使用する温度域で沈殿が生じないことを事前に確認下さい。測定中に沈殿が生じるとシステム内に詰まり、測定が出来なくなることがございます。

【日ごろのメンテナンス】

- ・ サンプル測定毎に *Cleaning Settings* を *Wash* にすることをお勧めします。
- ・ 最後のサンプルを測定する際、*Cleaning Settings* は *Scan* にすることで、セルに洗剤を入れた状態で熱をかけられるため、洗浄効果を高めることができます。その際は、次に測定する水スキャンの条件で、*Tend* を $80\text{ }^{\circ}\text{C}$ に設定する必要があります。*Scan* 実施時には、温度に上限がありますのでご注意ください。



- ・ *Scan* 実施後に超純水による測定を 2 回以上実施し、システムに汚れが残っていないかなどを確認します。このとき *Tend* はサンプル測定に使用した *Tend* にします。
- ・ 異常がないことが確認できたらシステムをシャットダウンします。

【システムチェック】

システムのコンディションを確認するために超純水を用いた測定を行っていただきます。ベースラインのドリフトや、再現性のないピークが得られるような場合は、以下の手順に従い、システムチェックを実施してください。

1. 超純水 $400\text{ }\mu\text{L}$ を 10 測定分セットします。
2. *New Sequence* をクリックします。
3. *Target Measurement File* に 'Systemcheck (任意) ' と入力します。

4. *Load* をクリックします。
5. *Load Settings* を以下のように編集します。
 - ・ *Sample Name*; Water (任意)
 - ・ *Sample Type*; Buffer
6. *Water* 内の *Scan* をクリックします。
7. *Scan Settings* を以下のように編集します。
 - ・ *Tstart*; 10
 - ・ *Tend*; 110
 - ・ *Scan Rate*; 200
 - ・ *Feedback*; None
 - ・ *Pre-Scan*; 3
 - ・ *Post-Scan*; 0
8. *Load* の *Duplicate* を 9 回クリックし、トータル 10 スキャン実施します。
測定結果を弊社までお送りください。

【長期間使用しない場合のメンテナンス方法】

Maintenance から *Wash* を選び、洗浄を行うようにしてください。

【汚れがひどい場合のメンテナンス】

- ◆ 以下の洗浄は、通常の洗浄を実施してもデータクオリティに改善が見られないときのみ実施します。また、サンプル測定時に沈殿が生じた場合にも使用可能です。
- ◆ クリーニング溶液をセルに必要以上、長時間曝すことはしないでください。

Step1 : クリーニング溶液の調整を行います。(手袋、保護眼鏡着用)

- 1) 5 グラムの水酸化ナトリウムを約 25 mL の超純水に溶かします。
- 2) 50 mL の次亜塩素酸ナトリウム溶液 (~10-15 % 塩素) を 1) に加えます。
- 3) 超純水で 100 mL にメスアップし、よく混合させます。

(保存方法)

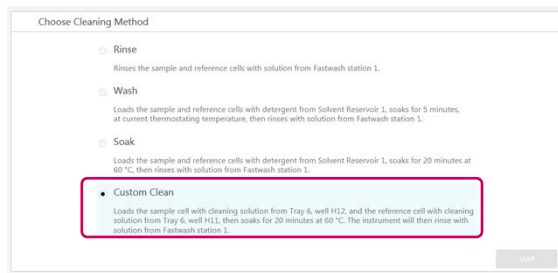
クリーニング溶液は密閉容器に暗所で保存すれば、少なくとも **1 年間**は有効です。

Step 2 : *Maintenance* の *Cell Clean* 内の *Custom Clean* を実施します。

- 1) *Cleaning Solution* を *Tray 6* の *well H11, 12* に 400 μ L セットします。

2) Maintenance の Cell Clean から Custom Clean を選び、指示に従います。

3) 洗浄終了後、システムチェックを実施します。



Choose Cleaning Method

- Rinse
Rinses the sample and reference cells with solution from Fastwash station 1.
- Wash
Loads the sample and reference cells with detergent from Solvent Reservoir 1, soaks for 5 minutes, at current thermostating temperature, then rinses with solution from Fastwash station 1.
- Soak
Loads the sample and reference cells with detergent from Solvent Reservoir 1, soaks for 20 minutes at 60 °C, then rinses with solution from Fastwash station 1.
- Custom Clean
Loads the sample cell with cleaning solution from Tray 6, well H12, and the reference cell with cleaning solution from Tray 6, well H11, then soaks for 20 minutes at 60 °C. The instrument will then rinse with solution from Fastwash station 1.

Start

お問合せ先

スペクトリス株式会社
マルバーン・パナリティカル事業部
カスタマーサポート窓口（ヘルプデスク）
support.japan@malvernpanalytical.com
フリーダイヤル 0120 57 17 14